特 許 協 力 条 約

10/540638

PCT.

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70] REC'D 07 OCT 2004

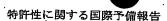
WIPO PCT

出願人又は代理人 の書類記号 TU03-0903WO1	今後の手続きについては	、様式PCT/	IPEA/416を	参照すること。			
国際出願番号 · PCT/JP03/12777	国際出願日 (日.月.年) 06.10	. 2003	優先日 (日.月.年) 1(	. 01. 2003	3		
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' C	23C14/34, C22	C19/03	-				
出願人 (氏名又は名称) 株式会社日鉱マテリ	リアルズ						
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条) の	きこの国際予備審査機関で の規定に従い送付する。	 作成された国際 <sup>-</sup>	予備審査報告である				
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。							
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a × 附属書類は全部で ページである。							
☑ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)							
第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙							
b 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示す。 ブルを含む。(実施細則第8(	ように、コンピュータ読み ) 2 号参照)	取り可能な形式(	(電子媒体の こよる配列表又は配	)種類、数を示す) 列表に関連するテ			
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。							
<ul><li>図 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎</li><li>□ 第 I 欄 優先権</li><li>□ 第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成</li><li>□ 第IV欄 発明の単一性の欠如</li></ul>							
<ul> <li>※ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明</li> <li>第VI欄 ある種の引用文献</li> <li>第VI欄 国際出願の不備</li> </ul>							
● 第四欄 国際出願に対す	る意見						
The state of the charter of the state of the	<u> </u>		- <u></u>				
国際予備審査の請求書を受理した日 04.03.2004	国際	予備審査報告を作 1	作成した日 3.09.2004 ——————				
名称及びあて先		<b>宁審査官(権限</b> の	つある職員)	4G 915	7		
日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番		前田(	二志				
	-	番号 しょーさい	581-1101	<b>劫给 2116</b>	- 1		

## 特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP03/12777

第I欄 報告の基礎	
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほ	か、国際出願の言語を基礎とした。
□ この報告は、	を基礎とした。 ある。
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6: た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この	条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され の報告に添付していない。)
出願時の国際出願書類	
※ 明細番       第 1-11     ページ、       第 ページ*、     ページ*、       第 ページ*、	
※ 請求の範囲       項、         第       項*、	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
第	付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 ページ/図*、 第 ページ/図*、	付けで国際子供室木機即は平型しょう。
3.  補正により、下記の勘類が削除された。	
<ul><li>□ 明細事</li><li>□ 請求の範囲</li><li>□ 図面</li><li>第</li></ul>	
□ 配列表(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載す	ること)
T no tomete	添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超れなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
財細書       第         請求の範囲       第         図面       第         配列表(具体的に記載すること)       配列表に関連するテーブル(具体的に記載する	ページ 項 ページ/図 ること)
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入	) . * th × > 1, 10 to 7
- Superboard Carl	、C4vのことかめる。



国際出願番号 PCT/JP03/12777

<b>. 見解</b>	<i>,</i> •	, .	,
新規性(N)	請求の範囲	1-10	
進歩性(IS)	請求の範囲	1-10	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-10	有 無

文献及び説明(PCT規則70. ?)

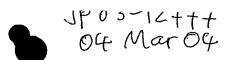
請求の範囲1-10に係る発明について 請求の範囲1-10に係る発明は、国際調査報告で引用された文献に対して新規

性、進歩性を有する。 国際調査報告で引用された文献には、タンタルを 0.5~10at%含有し、残部ニッケルである合金を、ゲート電極材料用スパッタリングターゲットとして用いることが記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないも のである。

12/4

## 請求の範囲

- 1. (補正後) タンタルを 0. 5~10 a t %含有し、残部ニッケルであることを特徴とするゲート電極材用ニッケルータンタル合金スパッタリングターゲット。
- 2. (補正後) タンタルを 1 ~ 5 a t % 含有し、残部ニッケルであること を特徴とするゲート電極材用ニッケルータンタル合金スパッタリングター ゲット。
- 3. (補正後) ガス成分を除く不可避不純物が100wtppm以下であることを特徴とする請求の範囲第1項~第2項に記載のニッケルータンタル合金スパッタリングターゲット。
- 4. (補正後) ガス成分を除く不可避不純物が10wtppm以下である ことを特徴とする請求の範囲第1項~第2項に記載のニッケルータンタル 合金スパッタリングターゲット。
- 5. (補正後)酸素が50wtppm以下、窒素、水素及び炭素がそれぞれ10wtppm以下であることを特徴とする請求の範囲第1項~第4項のそれぞれに記載のニッケルータンタル合金スパッタリングターゲット。
- 6. (補正後)酸素が10wtppm以下であることを特徴とする請求の 範囲第1項~第5項のそれぞれに記載のニッケルータンタル合金スパッタ リングターゲット。
- 7. (補正後) ターゲット面内方向の初透磁率が50以上であることを特徴とする請求の範囲第1項~第6項のそれぞれに記載のニッケルータンタル合金スパッタリングターゲット。
- 8. (補正後) ターゲット面内方向の初磁化曲線上の最大透磁率が100 以上であることを特徴とする請求の範囲第1項~第7項のそれぞれに記載 のニッケルータンタル合金スパッタリングターゲット。



- 9. (補正後) ターゲットの平均結晶粒径が80μm以下であることを特徴とする請求の範囲第1項~第8項に記載のニッケルータンタル合金スパッタリングターゲット。
- 10. (補正後) 再結晶温度~950° Cで最終熱処理を行うことを特徴とする請求の範囲第1項~第9項のそれぞれに記載のニッケルータンタル合金スパッタリングターゲットの製造方法。